

负性光刻胶厂家 四川负性光刻胶 北京赛米莱德公司

产品名称	负性光刻胶厂家 四川负性光刻胶 北京赛米莱德公司
公司名称	北京赛米莱德贸易有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市北京经济技术开发区博兴九路2号院5号楼 2层208
联系电话	15201255285 15201255285

产品详情

NR9-250P

20. 有没有光刻胶PC3-6000的资料吗？

A PC3-6000并不是光刻胶，它是用在chip
on glass 上的胶粘剂。

21. 是否有Wax替代品？

A PC3-6000可替代Wax做晶片和玻璃的固定，比较容易去除掉。

22. 贵公司是否有粘接硅衬底和衬底的材料？

A 有，IC1-200就是

23. 请问是否有不用HMDS步骤的正性光刻胶？

A 美国Futurrex 整个系列的光刻胶都不需要HMDS步骤，都可以简化。

24. 一般电话咨询光刻胶，我们应该向客户咨询哪些资料？

A 1 需要知道要涂在什么材质上，2

还有要知道需要做的膜厚，3

还要知道光刻胶的分辨率

4还有需要正胶还是负胶，5

需要国产还是进口的

27. 想找一款膜厚在120um，的光刻胶，有什么光刻胶可以做到啊！

A 以前有使用过美国有款光刻胶可以达到Futurrex

NR21-20000P，。

28. 有没有了解一款美国Futurrex

NR9-250P的光刻胶，请教下？

A 这是一款负性光刻胶，湿法蚀刻使用的，附着力很好，耐100度的温度，国内也有可以代理的公司，Futurrex

光刻胶是世界第4大的电子化学品制造商，在光刻胶的领域有着不错的声誉，在太阳能光伏，负性光刻胶哪里有，和LED半导体行业都有不错的市场占有率。

29. 想找款膜厚的产品，进行蚀刻，有什么好推荐？

A 厚膜应用 (thick

film applicati)，主要是指高纵横比 (Aspect

ratios)，负性光刻胶厂家，高分辨率，高反差，有几款产品向你推荐一下《NR4-8000P，四川负性光刻胶，NR2-20000P，NR5-8000，这些产品都需要用到边胶清洗液》

的光刻

NR77-25000P负性光刻胶

表征光刻胶特性和性能、质量的参数有以下三个：

(1)光学性质。光刻胶的光学性质包括光敏度和折射率。

(2)力学特性和化学特性。光刻胶的力学特性和化学特性包括胶的固溶度、黏滞度、黏着度、抗蚀(刻蚀、腐蚀)性、热稳定性、流动性和对环境气氛(如氧气)的敏感度。

(3)其他特性。光刻胶的其他特性包括胶的纯度、胶内的金属含量、胶的可应用范围、胶的储存有效期和胶的燃点。

光刻胶不仅具有纯度要求高、工艺复杂等特征，还需要相应光刻机与之配对调试。一般情况下，一个芯片在制造过程中需要进行10~50道光刻过程，由于基板不同、分辨率要求不同、蚀刻方式不同等，不同的光刻过程对光刻胶的具体要求也不一样，即使类似的光刻过程，不同的厂商也会有不同的要求。

针对不同应用需求，光刻胶的品种非常多，这些差异主要通过调整光刻胶的配方来实现。因此，负性光刻胶供应商，通过调整光刻胶的配方，满足差异化的应用需求，是光刻胶制造商核心的技术。

此外，由于光刻加工分辨率直接关系到芯片特征尺寸大小，而光刻胶的性能关系到光刻分辨率的大小。限制光刻分辨率的是光的干涉和衍射效应。光刻分辨率与曝光波长、数值孔径和工艺系数相关。

负性光刻胶厂家-四川负性光刻胶-北京赛米莱德公司由北京赛米莱德贸易有限公司提供。北京赛米莱德贸易有限公司（www.semild.com）为客户提供“光刻胶”等业务，公司拥有“赛米莱德”等品牌，专注于工业制品等行业。欢迎来电垂询，联系人：况经理。